

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公開番号】特開2006-258631(P2006-258631A)

【公開日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2006-038

【出願番号】特願2005-76947(P2005-76947)

【国際特許分類】

G 01 N 21/93 (2006.01)

G 01 N 21/956 (2006.01)

G 02 F 1/13 (2006.01)

G 09 F 9/00 (2006.01)

H 01 J 9/02 (2006.01)

H 01 J 11/02 (2006.01)

【F I】

G 01 N 21/93

G 01 N 21/956 Z

G 02 F 1/13 1 0 1

G 09 F 9/00 3 5 2

H 01 J 9/02 F

H 01 J 11/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月10日(2008.3.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面にパターンを形成した基板を水平状態に支持するステージ部と、  
前記基板を前記ステージ部の表面に沿って一方向に搬送する搬送機構と、  
前記搬送方向に直交する略直線状の照射光を前記基板の表面の照射領域に照射するライン  
照明ユニットと、  
前記照射領域からの反射光を受光して撮像するカメラユニットと、  
前記照射領域に対してその長手方向に移動可能な基準ユニットと、  
該基準ユニットに設けられ、前記照射領域を通過する表面に基準パターンを形成したキャ  
リブレーション用の基準基板とを備えることを特徴とする基板検査装置。

【請求項2】

前記ステージ部が、非接触状態に前記基板を浮上させる浮上ステージ部からなり、  
前記基板に対向し、前記ライン照明ユニットの照射光が入射する前記浮上ステージ部の表  
面上に、前記照射領域の長手方向にわたる略直線状の溝が形成され、  
前記基準ユニットが、前記溝の内部を移動することを特徴とする請求項1に記載の基板検  
査装置。

【請求項3】

前記基準ユニットが、前記照射領域の長手方向に沿う軸線を中心に回転自在な略円柱状の  
回転部材からなり、  
該回転部材の周面に前記基準基板が配され、該基準基板が前記回転部材の回転により前記

ステージ部の表面に対して出没することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の基板検査装置。

【請求項 4】

前記基準基板の基準パターンが鏡面であることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の基板検査装置。

【請求項 5】

前記基準ユニットは、前記基準基板の表面を前記ステージ部の表面に向けた状態で固定され、出没機構により前記ステージ部の表面に直交する方向に移動させて前記ステージ部の表面に対して出没することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の基板検査装置。

【請求項 6】

前記基準基板の表面の高さは、前記ステージ部に浮上させた基板の表面と同じ高さに位置することを特徴する請求項 2 から 5 のいずれか 1 項に記載の基板検査装置。

【請求項 7】

前記基準ユニットの基準パターンは、反射率の異なる複数の領域またはラインが形成されていることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の基板検査装置。